

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

<p>(21) เลขที่คำขอ 2101005113</p> <p>(22) วันที่ยื่นคำขอ 30 สิงหาคม 2564</p>	<p>(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10 B05D 3/10</p>
<p>(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก</p> <p>-</p> <p>(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก</p> <p>-</p> <p>(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก</p> <p>-</p>	<p>(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร</p> <p>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p> <p>(72) ผู้ประดิษฐ์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ</p> <p>นางสาวเกศรา อาษานอก</p> <p>(74) ตัวแทน</p> <p>-</p>
<p>(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ กระบวนการปรับสภาพพื้นผิวพอลิโพรพิลีนปิเปต</p> <p>(57) บทสรุปการประดิษฐ์</p> <p>ในการประดิษฐ์นี้เสนอกระบวนการปรับสภาพพื้นผิวพอลิโพรพิลีนปิเปตทึบ ที่ประกอบด้วยการสร้างชั้นบางของพอลิเมอร์เอทิลีน ไกลคอล ไดเมทาคริเลท ตรึงไว้บนผิวของพอลิโพรพิลีนปิเปต โดยบรรจุสารละลาย 2,2-ไดเมทอกซี-2-ฟีนิลอะซีโทฟีโนน ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์โดยมวล ในตัวทำละลายเมธานอล ลงในพอลิโพรพิลีนปิเปตทึบ เพื่อให้ 2,2-ไดเมทอกซี-2-ฟีนิลอะซีโทฟีโนน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยาติดซับอยู่บนผิวพอลิโพรพิลีนปิเปตทึบ ก่อนที่สารละลาย 2,2-ไดเมทอกซี-2-ฟีนิลอะซีโทฟีโนน ที่เหลือในปิเปตทึบออก จากนั้นทิ้งให้แห้ง แล้วเติมสารละลายเอทิลีน ไกลคอล ไดเมทาคริเลท ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยมวล ที่ในตัวทำละลายเมธานอล ลงในพอลิโพรพิลีนปิเปตทึบที่มี 2,2-ไดเมทอกซี-2-ฟีนิลอะซีโทฟีโน ติดซับอยู่บนผิว ก่อนนำไปฉายแสงยูวี หลังจากการฉายแสงให้ทั้งพอลิเมอร์เอทิลีน ไกลคอล ไดเมทาคริเลท ส่วนเกินในปิเปตทึบออก จะคงเหลือเฉพาะชั้นบางของพอลิเมอร์เอทิลีน ไกลคอล ไดเมทาคริเลท อยู่บนผิวของพอลิโพรพิลีนปิเปตทึบที่พร้อมสำหรับใช้ในการสังเคราะห์ตัวดูดซับโมโนลิธต่อไป</p> <p>(ข้อถ้อยสิทธิ 5 ข้อ, รูปเขียน 1 รูป)</p>	